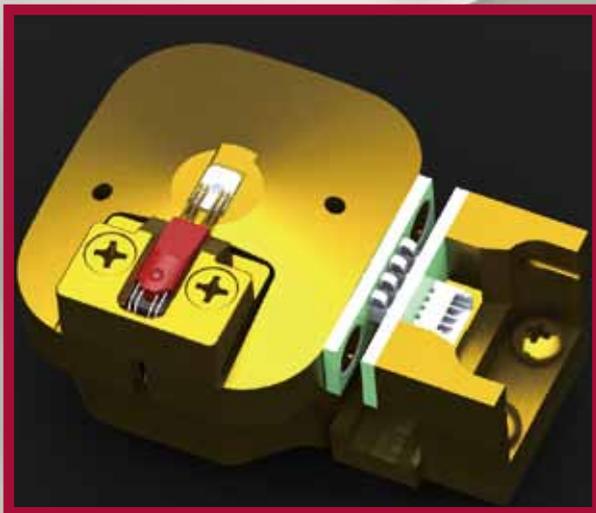
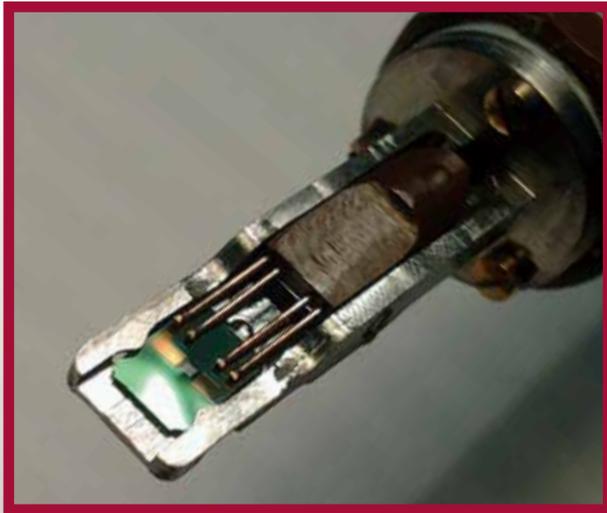




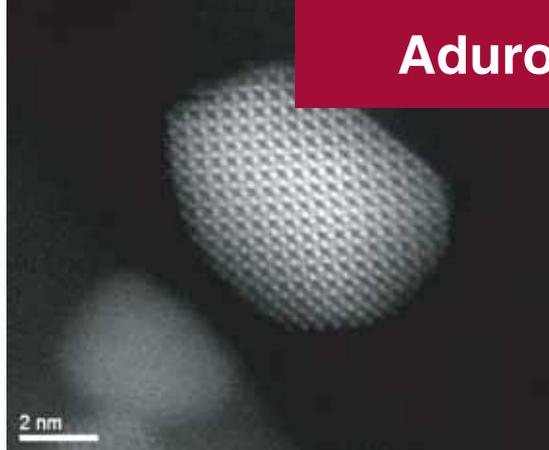
Protochips

电镜原位突破

超高温加热，电性能及液体环境的测试平台



Tegent
德祥



在 1000° C 的原子分辨率

图片由博士拉里·阿拉德橡树岭国家实验室提供

Protochips

系统介绍

Aduro™ 使电子显微镜的分析能力进行革命性的突破，通过提供表征温度在 1200°C 电性能或加热的原位原子分辨率的能力。事实上，Aduro™ 提供加热速率高达 1,000,000°C/秒。快速热加速时间可允许量化，应用于材料和工艺的动态反应研究分析，这对于其他研究方式分析不可实现的。

利用我们革命性的 E-CHIP™ 标本支持技术，Aduro™ 是最灵活和高性能在原位加热和电性测试平台。1 或 2 个通道可利用，每个通道可以单独配置您的样品，只需选择使用哪个 E-CHIP™，提供加热或者电性能测试。

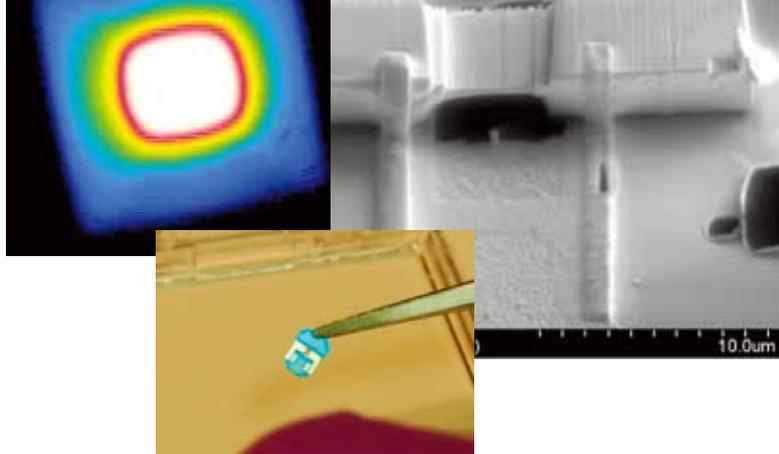
Aduro™ 系统由 TEM 载台（SEM 平台），外接电源，控制器与软件，必需的电缆和使用说明书组成。单一倾斜的载台适合大多数的 TEM/STEM 和 SEM 等仪器。样本尖端有一个专有的弹簧夹设计，可以快速简便的装载和卸载 E-CHIP™ 标本而不需要额外的工具。

Aduro™ 特点和优点

特点	优点
电和热刺激	系统提供了一个平台，供研究使用
E-chip 样本的支护技术	超高的稳定性和低漂移。小于 1 毫秒响应温度变化
	非常精确的温度和试样的电流 / 电压控制
	惰性，能够达到的温度从室温到 1200°C
	一次性设计，消除污染，并兼容大多数 TEM/STEM 和 SEM 的仪器

规格

温度范围	室温 -1200°C 的环境
渠道	单或双通道设计（2 或 4 个引线）
倾斜 (α 和 β)	精确的倾斜度取决于杆件的配置和系统
Aduro E-chip 尺寸	4.0 毫米 × 5.8 毫米，300μm 厚
观测区域	500 微米 × 500 微米
功率要求	110/220V



在 1000° C 的原子分辨率



Aduro 的 E-chip 为热应力及电特性材料的样品提供一个革命性的产品平台。

利用最先进的设计和制造的半导体技术, E-chips 使 Aduro 家族具有前所未有的性能和灵活性。热 E-chips 为精确的温度控制、超低漂移提供一个平台, 温度可达 1200°C 和升温速率达到 1000000°C / 秒。电气 E-chips 在当前电流偏精确或电压模式提供一个平台, 在现有的水平, 电流从毫微安到 100 倍的毫安和当前电压升高至 50V。

耗材

Aduro 的 E-chip 作为半导体耗材设备来代替传统的透射电镜光栅。E-chips 家族包括提供热, 电气或支持样本电热刺激的耗材。陶瓷薄膜具有微米级孔区域, 使样本可通畅成像。对于非常微小的颗粒, Aduro™ 设备在表面上提供薄、非晶硅薄膜, 它支持样品加热和成像时透过小孔。耗材设计也最大限度地减少系统污染, 为每一个实验提供一个持续可靠的加热和 / 或电性能平台。Aduro 的 E-chip 支持与兼容的各种样品及样品制备技术, 包括纳米导线, 超薄薄膜和 FIB 部分。

ADURO E-CHIP™ 特点和优点

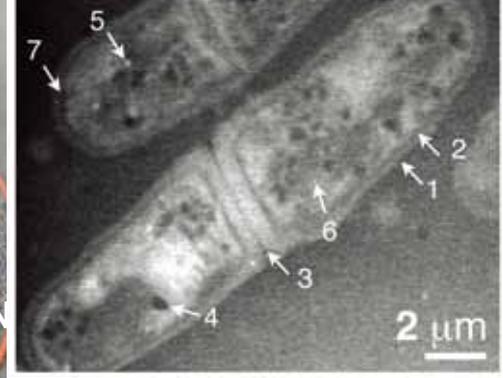
特点	优点
极低的热质	超高的稳定性和低漂移, 小于 1 毫秒的温度响应
支持薄膜直接加热	试样温度控制精确
超强劲的半导体陶瓷材料	惰性, 能从环境温度达到 1200°C
耗材半导体样本支持设备	一次性设计无污染, 兼容大多数 TEM/STEM 和 SEM 仪器

规格

温度范围和斜率	室温到 1200°C, 高达 1,000,000°C 间每秒
电刺激	电流或电压模式, 从纳安到 100 倍毫安高达 50V
Aduro 的 E-chips 样本支持尺寸	4.0mmx5.8mm, 300µm 厚
观察区域	500µmx500µm
电极配置	适合多种样品从纳米材料到薄膜和 FIB 部分的高温加热以及电性能测试
功率要求	110/220V



NANOMETER RESOLUTION



Protochips

Poseidon™ 是电镜能在液体环境中原位成像的革命性突破。从生物标本到材料科学的应用，Poseidon™ 在允许最高分辨率条件下，对材料在母体环境中进行研究。包括活体细胞，电池，催化剂，乳液，凝胶和其他软质材料，都可以使用我们的平台系统。

使用我们革命性的 E-chip™ 标本的支持技术，Poseidon™ 提供了一个样品在液体环境中原位成像的解决方案。因为没有两个标本是相同的，任何一个 E-chip™ 样品支持的选择，可搭配提供各种各样的窗口几何形状，液体层厚度和流电路径。这种灵活性允许用户在不用添加新硬件的实验基础上定制实验条件。

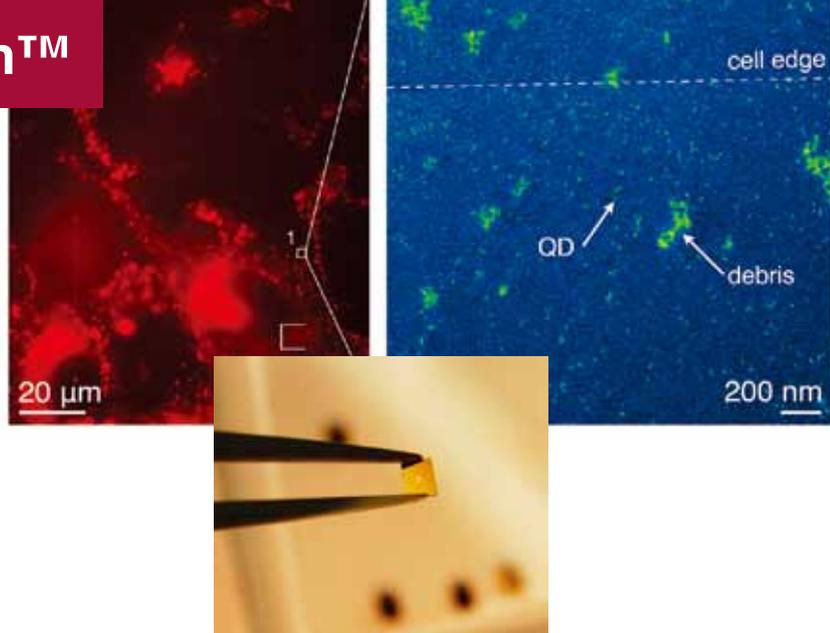
Poseidon™ TEM 支架可提供 2 或 3 个端口配置。2 端口配置允许定量流体通过样品，3 端口配置可以直接在尖端引入和混合试剂。Poseidon™ 系统自带 TEM 支架，控制流量的注射泵和所需的管材及配件。

Poseidon™ 功能和特点

功能	特点
液体流量	成像时恒量液体通过样品
2 或 3 端口配置	2 端口配置允许液体流入流出 3 端口配置允许样品直接混合试剂
可替换 E-chip™ 样品支持	用户可配置的功能包括液体层厚度，流电路径和窗口几何形状 易装载，易清理每个实验样品支持窗口

规格

液体层厚度	根据 Poseidon E-chip™ 选择 (纳米到微米)
端口	2 或 3 端口配置
倾斜 (α)	精确倾斜依赖于极片；样品针尖
Poseidon™ E-chip™ 尺寸	2.0mm x 2.6mm, 300μm 厚
观察区域	长: 200-400μm, 宽: 50-70μm
电源要求	110/220 VAC



Poseidon™ E-chip 家族提供了一个无与伦比的 Poseidon™ 液体原位平台。为了容纳各种各样在材料和生命科学中使用的样品，E-chip™ 平台给用户提供了在实验基础上选择实验设备的功能。液体层厚和浏览窗口的尺寸，这些规格是完全由用户自己对样品的 E-chip™ 做的最合适选择。

耗材

Poseidon™ E-chip 耐用，非晶态窗口能够为液体和最低散射光束提供强大的屏蔽作用。采用最先进的半导体集成垫片，光刻技术，为通道液体流量以及两个 E-chip™ 之间的液体层厚度提供模式。Poseidon E-chip™ 可制成不同窗口大小和垫片厚度，通过 E-chip™ 的选择确定观察区域和液体层厚度。

衬垫材料和非晶态窗口制造所使用的材料对于多数液体和样品制备技术都是最坚固耐用的。Poseidon™ E-chip 耗材无与伦比的灵活性、性能和坚固，在生命和材料科学应用中，Poseidon™ 平台对于原位液体分析是完美的选择。

Poseidon™ E-chip 功能和特点

功能	特点
坚固的窗口和衬垫材料	兼容不同的样品，液体和样品制备技术
集成垫片	液体层厚度在 E-chip™ 选择上可完全定制
窗口几何尺寸	提供可选择观察区
超坚固半导体窗口材料	惰性膜都是坚固和非晶态的，减少光散射

规格

Poseidon E-chip™ 尺寸	2.0mm x 2.6mm, 300μm 厚
液体层厚度	基于 E-chip™ 的选择 (纳米到微米)
观察区	长从 200-400μm, 宽从 50-70μm

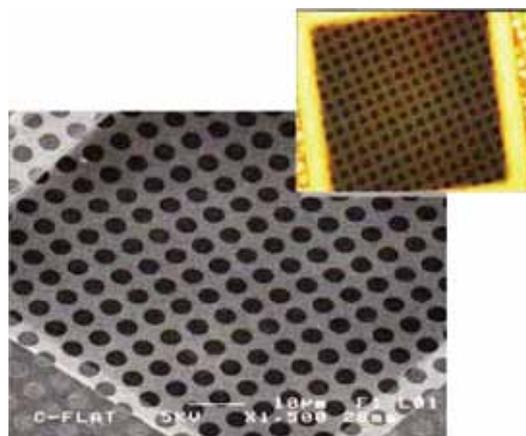
C-flat 多孔碳薄膜

C-flat 是一个超平面，多孔碳包覆的支撑膜用于透射电子显微镜 (TEM)。不同于其它竞争产品多孔碳薄膜，由于 C-flat 是由无塑料制造，因此它干净无残留物。

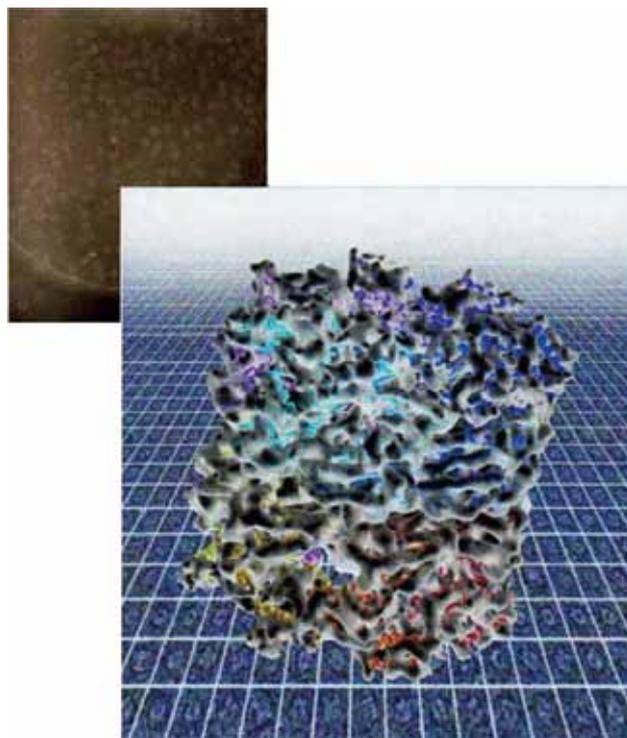
专利技术制造的 C-flat 提供了一个超平坦的表面，对颗粒的更好分散性和冰层厚度均匀性起到好的效果。图形是采用先进的光刻技术，确保最准确和一致的孔的形状和亚微米的大小特征。

产品	孔直径	孔空间	网格 / 种类
CF-MH-2C	见下	见下	200/Cu
CF-MH-3C			300/Cu
CF-MH-4C			400/Cu
CF-1/1-2C	1.0 μ m	1.0 μ m	200/Cu
CF-1/1-3C			300/Cu
CF-1/1-4C			400/Cu
CF-1/4-2C	1.0 μ m	4.0 μ m	200/Cu
CF-1/4-3C			300/Cu
CF-1/4-4C			400/Cu
CF-1.2/1.3-2C	1.2 μ m	1.3 μ m	200/Cu
CF-1.2/1.3-3C			300/Cu
CF-1.2/1.3-4C			400/Cu
CF-2/0.5-2C	2.0 μ m	0.5 μ m	200/Cu
CF-2/0.5-3C			300/Cu
CF-2/0.5-4C			400/Cu
CF-2/1-2C	2.0 μ m	1.0 μ m	200/Cu
CF-2/1-3C			300/Cu
CF-2/1-4C			400/Cu
CF-2/2-2C	2.0 μ m	2.0 μ m	200/Cu
CF-2/2-3C			300/Cu
CF-2/2-4C			400/Cu
CF-2/4-2C	2.0 μ m	4.0 μ m	200/Cu
CF-2/4-3C			300/Cu
CF-2/4-4C			400/Cu
CF-4/1-2C	4.0 μ m	1.0 μ m	200/Cu
CF-4/1-3C			300/Cu
CF-4/1-4C			400/Cu
CF-4/2-2C	4.0 μ m	2.0 μ m	200/Cu
CF-4/2-3C			300/Cu
CF-4/2-4C			400/Cu

多孔的产品包含圆形从 1.0 至 2.0 μ m 和椭圆形从 1.0 \times 4.0 μ m 到 2.0 \times 8.0 μ m

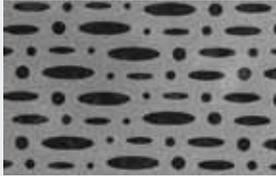
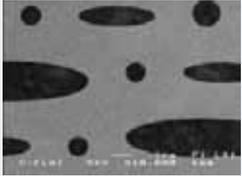
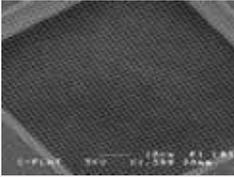
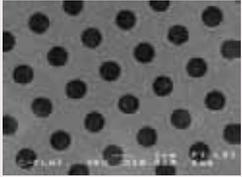
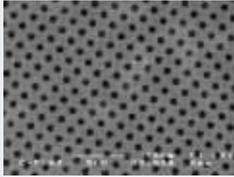
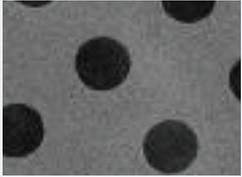
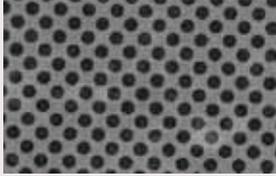
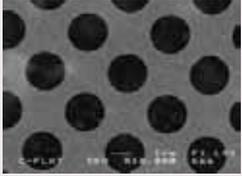
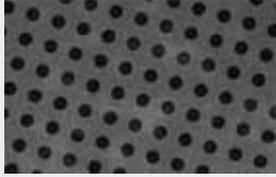
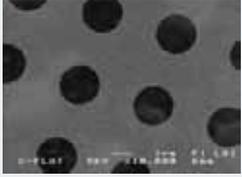
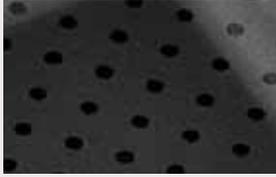
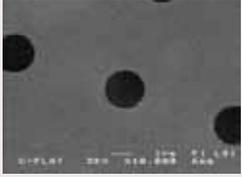
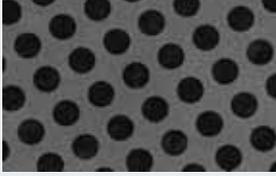


CF-4/2-2C (4.0 μ m 和 2.0 μ m 间距孔), 发射扫描电镜成像



GroEL 在 24 小时内的 250,000 颗粒
图片由斯科特·斯塔格和迈克的皮克 NRAMM, 斯克里普斯研究所

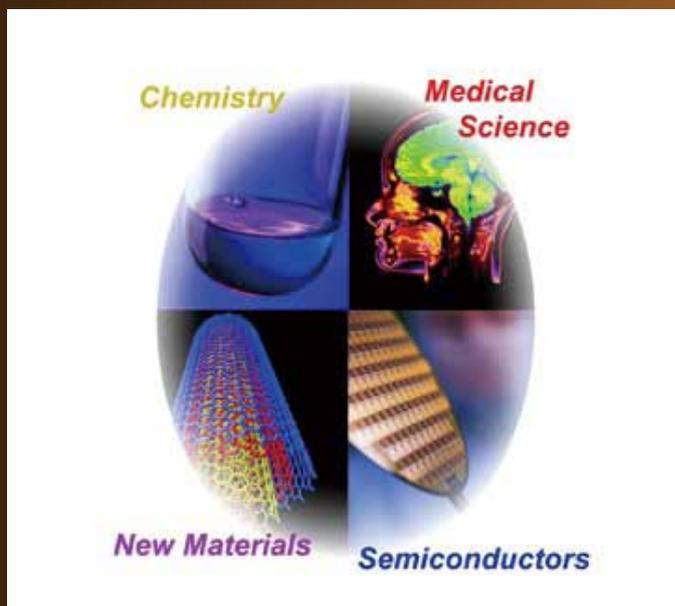
C-flat 产品系列

产品	图片	10000X
CF-MH-2C CF-MH-3C CF-MH-4C Multi-hole and space		
CF-1/1-2C CF-1/1-3C CF-1/1-4C		
CF-1.2/1.3-2C CF-1.2/1.3-3C CF-1.2/1.3-4C 1.2 μm hole, 1.3μm space		
CF-2/1-2C CF-2/1-3C CF-2/1-4C 2.0 μm hole, 1.0 μm space		
CF-2/2-2C CF-2/2-3C CF-2/2-4C 2.0 μm hole, 2.0 μm space		
CF-2/4-2C CF-2/4-3C CF-2/4-4C 2.0 μm hole, 4.0 μm space		
CF-4/2-2C CF-4/2-3C CF-4/2-4C 4.0 μm hole, 2.0 μm space		

C-flat 安装使用碳磁带存根，并与场发射扫描电子显微镜 -2C 影像：200 目铜网格；-4C：400 目铜格

C-flat200, 300, 400 铜网格数量为 2550 和 100 是立即可用的。其他金属和专业网格可根据要求提供，所以请留意 Protochips 在 919, 341, 2612 更多信息。

DuraSiN™



简介

DuraSiN™ 氮化硅膜和载网产品改变了透射电镜样品准备和分析的方式。

DuraSiN™ 膜和载网产品对于透射电镜和 X 射线分析是合理的成本定价，耐用，无机，低散射支持。产品是由薄而高质量的氮化硅膜围绕在刚性硅衬底的周围。

不同于其他支持膜和网架，DuraSiN™ 氮化硅膜和载网产品能经受严酷的化学和温度环境。例如，DuraSiN™ 氮化硅膜和丝载网可用作为基材，在强酸溶液中纳米线直接生长在该基材上，一旦纳米线长成，样品直接用于在透射电镜中成像和分析。

概述

DuraSiN™ 氮化硅膜和载网产品对于透射电镜和 X 射线分析是合理的成本定价，耐用，无机，低散射支持。对于最高分辨率，DuraSiN™ 提供了理想的成像和分析平台。

DuraSiN™ 氮化硅膜

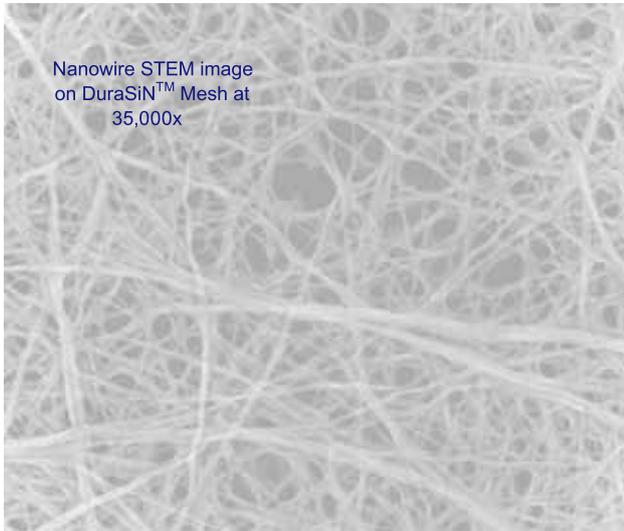
DuraSiN™ 氮化硅膜由两种材料组成。样品观察区是防化学腐蚀、低应力、平面氮化硅膜，刚性硅框架支持了这个观察区，硅框架的厚度在 200 – 600 微米之间。对于样品的准备、清洗、成像和分析，DuraSiN™ 氮化硅膜的支持网架提供了一个具有成本效益和持久性的平台。

胶体、粉末、气雾剂和聚合物的完美分析，耐久、无机、低散射基材的 DuraSiN™ 氮化硅膜对于定量透射电镜和 X 射线分析价格合理适中。DuraSiN™ 的基材制造高质量，低应力氮化硅，刚性硅衬底。DuraSiN™ 薄膜产品对于多数清洁剂包括丙酮，乙醇，氧等离子体和紫外臭氧耐受性好。产品尺寸从标准透射电镜 (2.65mm 直径) 到大于 10mm 的 X 射线应用。

DuraSiN™ 载网

DuraSiN™ 载网也由强化学性，低应力，平面氮化硅膜制成，由刚性硅框架支撑。且有规则排列的小孔，小孔通过观察区从而提供真正的电子透射区样品成像和分析。DuraSiN™ 载网基材提供了独特的无机膜和电子束完全透光区域。

这两个特点给电镜操作和分析人员提供了无与伦比的成像和分析。像其他多孔和莱西支持膜，DuraSiN™ 载网基板提供区域畅通的支持膜。事实上，DuraSiN™ 网是由无机氮化硅组成，可以彻底清洗（如等离子体）固定于基板上的样品，从而保证成像是样品而非污染物。例如：在分析碳纳米管时，DuraSiN™ 载网提供一个清洁、无碳支持，隔离样品的碳污染。



特点和优势

DuraSiN™ 薄膜和载网用于 X 射线和 TEM 化学和机械耐受性好，价格适中，相对于传统的碳支持膜优势很明显。如果研究涉及到样品在恶劣的环境中生长或沉积，DuraSiN™ 是最佳的选择。能承受任何酸、碱或溶剂，允许胶体、纤维、纳米颗粒、粉末、聚合物和纳米线直接沉积或生长在支持膜表面。其温度可以稳定达到 1000°C，甚至直接使用半导体行业标准物理气相沉积，包括包括化学气相沉积，溅射，电子束蒸发。直接沉积或生长在 DuraSiN™ 上，消除了样品从生长膜到支持膜转移的过程。温度的稳定性同样可以在样品沉积，生长退火不同时期进行动态观察。

DuraSiN™ 支持膜的机械稳定性对于特别是 TEM，X 射线和 AFM 提供了完美的全面分析。不仅允许样品直接沉积和生长，同时 AFM 可以直接接触膜，使显微镜在可视区域内分析内部结果和表明细节。此外，在无需基础支架消除粗糙度和污染，DuraSiN™ 机械强度提供了大面积支持膜。

清洁问题是大家所关注的，特别是使用 EDAX 做成分分析，DuraSiN™ 的清洗优于含碳的支持膜，可以使用硫酸去除有机物，同样可以使用辉光放电和等离子体清洗使用这些技术，为样品沉积和生长提供无碳的表面。

DuraSiN™ 可以定制不同形状和大小的载网，是唯一提供孔径为 1 微米的产品，可以观察短纤维或线，在同类产品中它是最高质量，高性价比的产品。

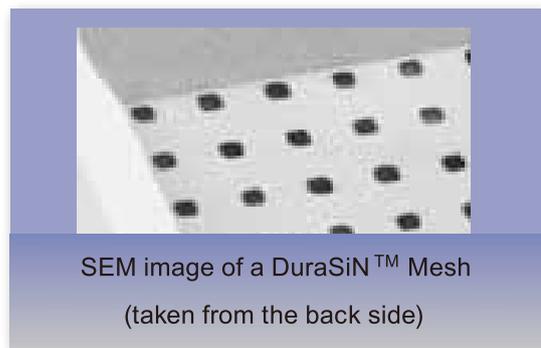
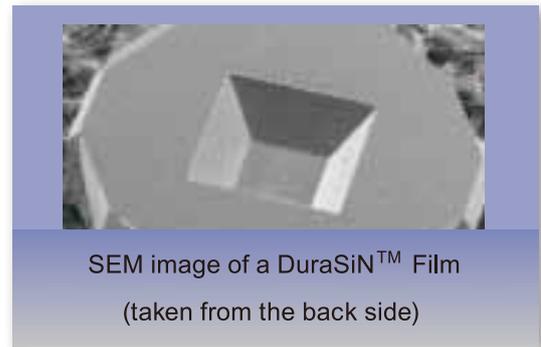
应用

- 1、含碳样品分析：光阻剂、聚合物、食品、油品、染料
- 2、化学沉积和生长：纳米线、碳纳米管、胶体、自组装单分子膜
- 3、颗粒分析：粉末、气溶胶、纳米颗粒、空气颗粒
- 4、化学反应：催化剂、活性部分
- 5、新材料研发：多元分析、高温、酸性 / 碱性样品

DuraSiN™ 膜

DuraSiN™ 薄膜产品是专门为 TEM/STEM 和 X 射线显微镜设计的支持膜，几乎可以承受任何样品沉积或生长的环境。如果样品需要暴露在高温、酸、碱和溶剂中，直接生长在 DuraSiN™ 薄膜上的样品不需要转移到另外一个用于成像的支持膜上。自组装单分子膜可以在 DuraSiN™ 上形成薄膜，之后附着纳米颗粒。

胶体、粉末、气溶胶和聚合物完善的分析，DuraSiN™ 薄膜价格适中，耐用，无机，低散射。组合在一起形成一个密闭的环境可以应用于湿电池。我们的薄膜足以多元分析，包括 AFM 和 TEM 使用相同的支持膜。



DuraSiN™ 载网

DuraSiN™ 载网是一个出色的产品，包含了所有薄膜产品的优点，在膜上有电子透明区的小孔。小孔可以是不同形状大小的，至亚微米。

DuraSiN™ 薄膜是样品的理想支架，包括纤维、胶体、纳米线和粉末。刚性硅框架提供了 AFM 分析区域，TEM，STEM 和 X 射线的微米透射窗口区域。消除了结合显微技术分析不同样品的实验歧义。样品可直接在 DuraSiN™ 薄膜上沉积或生长，然后单个样品在 TEM、STEM、AFM 和 X 射线中分析。根据 DuraSiN™ 窗口厚度和 AFM 针尖压力，一些用户甚至直接用 AFM 在薄膜上测试样品。

定制

我们知道每位客户都有独特需求。由于在成分和尺寸上标本有极大的区别，DuraSiN™ 发现在大量分析和成像技术应用上，没有理想化的产品形态和尺寸。为了满足研究团体多样化以及高要求的需求，DuraSiN™ 膜和 Mesh 能促进产品定制化以及满足使用者特殊要求。例如，使用 X 光显微镜的技术人员可能对有较大窗口区域及较厚氮化硅薄膜的 DuraSiN™ 产品感兴趣。使用特殊样品夹具的显微镜用户可能对有较大框架直径的 DuraSiN™ 产品感兴趣。最终，对于要求严苛的应用，超薄氮化硅薄膜（<50 微米）可能正是所需求的。

DuraSiN™ 产品可以特别定制为达到特殊的氮化硅薄膜、硅框架厚度、窗口区域、和 / 或框架区域要求。大多数自定的尺寸变化可以在 3 到 4 周内调节完成，其他的定制要求可以在 4 至 6 周内完成。请注意定制的产品可能相对会贵些，且若定制数量很少则需要申请。

虽然几乎任何参数定义的 DuraSiN™ 产品构造都可以特别定制，但一般仍需考虑以下参数范围：

描述	TEM DuraSiN™ 膜	TEM DuraSiN™ 网	X 光 DuraSiN™ 膜
膜厚度	30 纳米 -200 纳米	30 纳米 -200 纳米	50 纳米 -200 纳米
窗口区域	0.03 毫米 -0.7 毫米	0.2mm-0.7 毫米	0.5 毫米 -5 毫米
框架直径	2.65 毫米	2.65 毫米	2.65 毫米 -15 毫米
框架厚度	200 微米 -600 微米	200 微米 -600 微米	200 微米 -600 微米
孔尺寸	无	>0.8 微米	无
孔间距	无	根据孔尺寸及形状	无

薄膜厚度

标准 DuraSiN™ 产品氮化硅薄膜厚度是 50 纳米，100 纳米，200 纳米。定制的薄膜可以用 20 纳米到几微米厚度的氮化硅薄膜来制造。通常情况下，非常薄的窗口（小于 50 纳米）和小窗口区域是兼容的，与此同时，较厚的窗口可以与任何窗口区域搭配使用，包括大区域窗口。应当注意 / 注明的是由于易碎性极，极其薄的窗口必须非常小心处理。

窗口区域

标准 DuraSiN™ 产品的方形窗口边沿长度从 500 微米到 5 毫米不等。定制的窗口区域可以由范围从微米到毫米的窗口区域定制。较大窗口区域是薄膜厚度的功能，较厚的氮化物可以生产出较大的窗口。非常小的窗口同样可以定制，但是，由于工艺的限制，样品的不同，这些小窗口可能会出现一个较大的窗口尺寸变化，变化范围在 50 μm +/- 20 μm 。也可以根据定制的尺寸生产矩形窗口（有时被称作“插槽网格”）。

框架直径

标准 DuraSiN™ 产品的框架直径范围是从 2.65 毫米到 10 毫米。定制的框架直径范围是从 2.65 毫米到 10 毫米不等。通常情况下，较大窗口区域要求更大的框架直径。最小框架直径可制成透射电镜尺寸 2.65 毫米，目前通过 EMS 可以提供 5 毫米至 10 毫米的框架尺寸。然而，任何在 2.65 毫米至 15 毫米的尺寸都可定制订购。

关于德祥



自1992年创办以来，德祥就一直是实验室及工业检测仪器设备和服务行业的领导供应商。德祥总部设在香港，并且我们在中国和越南建立起了强大的销售网络，共有20个办事处和销售点，1个样机实验室、280多名雇员，以及众多的分销商。

作为国内科学仪器行业的领导供应商，我们服务于生命科学、工业、制药、政府、食品和农业、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域。

凭借与世界知名科学仪器制造商之间的战略合作关系，以及不断优化公司自身运作和服务质量，德祥每年都为数以万计的客户供应产品。



公司文化与价值观

我们本着诚信、公开、诚实和公平的原则开展业务，努力营造与员工和客户之间互相尊重、坦诚沟通、高效互动的健康环境。

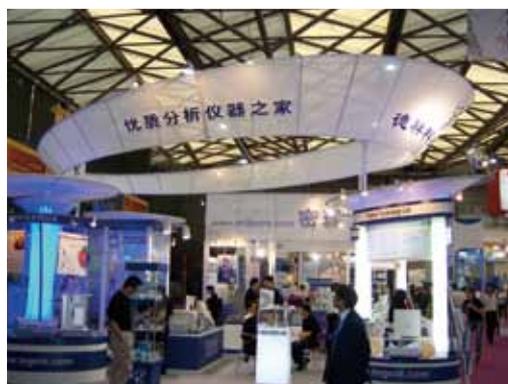
对于客户，德祥致力于了解他们的实际需求，并尽力满足他们的近期和长期需求。我们之所以能对客户作出这样的承诺，是因为德祥一直在员工们的创新和努力下不断进步。

对于员工，我们把员工当成公司的主人，公司的资源也就是员工的资源。我们为员工提供学习培训机会、公平的绩效管理制度、安全的工作环境等，从而实现员工自身的进步和成长。团队合作精神是成功的必备条件。



我们自豪地拥有

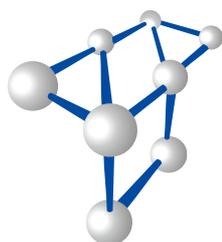
- 富有激情、高度专业化的领导和团队
- 良好的历年业绩和信誉
- 覆盖全国的销售网络
- 专业的应用和技术支持
- 完备的售后服务，包括客服、服务热线及后勤运作



我们的宗旨

作为全球卓越仪器的供应商，为了满足每一个领域客户的需要，我们提供：

- 完整的解决方案
- 先进的产品
- 专业的技术支持
- 满意的客户服务



Tegent
德祥

www.tegent.com.cn
info@tegent.com.cn
客服热线: 4008-822-822

主要办事处

总部
香港九龙官塘鸿图道26号
威登中心2602-05室
Tel: (852) 2759 2182
Fax: (852) 2758 3830

北京办事处
北京市海淀区知春路9号
坤讯大厦1506室 (100191)
Tel: (010) 8232 7383
Fax: (010) 8232 9551

成都办事处
成都市科华中路9号
天府汇城商务楼A座10楼1001室 (610041)
Tel: (028) 8535 6001
Fax: (028) 8535 6002

昆明办事处
昆明市拓东路80号
绿洲大酒店写字楼906室 (650041)
Tel: (0871) 3157 211
Fax: (0871) 3157 015

深圳办事处
深圳市深圳南大道6021号
喜年中心A座1905-1906室 (518040)
Tel: (0755) 8287 0304
Fax: (0755) 8287 0327

西安办事处
陕西省西安市高新区科技路50号
金桥国际广场A座10601室 (710061)
Tel: (029) 8860 8542
Fax: (029) 8860 8542

青岛办事处
青岛市市南区山东路40号
广发金融大厦1301室 (266000)
Tel: (0532) 8501 2820
Fax: (0532) 8501 1007

上海办事处
上海市静安区北京西路1068号
银发大厦18楼 (200041)
Tel: (021) 5261 0159
Fax: (021) 5261 0122

广州办事处
广州市中山五路219号
中旅商业城1505室 (510030)
Tel: (020) 2227 3388
Fax: (020) 2227 3368

厦门办事处
厦门市后埭溪路28号
皇达大厦15楼A2BC (361004)
Tel: (0592) 5185 885
Fax: (0592) 5185 886

南宁办事处
南宁市民族大道38-2号
泰安大厦18楼09室 (530022)
Tel: (0771) 5890 482
Fax: (0771) 5890 402

大连办事处
大连市中山区上海路42号
都市银座603室 (116000)
Tel: (0411) 8454 3771
Fax: (0411) 8454 3771

杭州办事处
杭州市拱墅区登云路518号
西城时代2幢801室 (310013)
Tel: (0571) 8722 9873
Fax: (0571) 8722 9873

长沙办事处
长沙市天心区五一一路717号
五一新干线B座2209室 (410015)
Tel: (0731) 8546 8872
Fax: (0731) 8489 7816